

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007年10月18日 (18.10.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/116669 A1

- (51) 国際特許分類:
C11D 3/37 (2006.01) C23G 5/036 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/056158
- (22) 国際出願日: 2007年3月26日 (26.03.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-098588 2006年3月31日 (31.03.2006) JP
特願2006-345763
2006年12月22日 (22.12.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 花王株式会社 (KAO CORPORATION) [JP/JP]; 〒1038210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田村 敦司 (TAMURA, Atsushi). 堀尾 安則 (HORIO, Yasunori).
- (74) 代理人: 細田 芳徳 (HOSODA, Yoshinori); 〒5406591 大阪府大阪市中央区大手前一丁目7番31号 OMMビル5階 私書箱26号 細田国際特許事務所内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CLEANING COMPOSITION

(54) 発明の名称: 洗浄剤組成物

(57) Abstract: Disclosed is a cleaning composition used for cleaning a substrate for recording medium, a substrate for photomask or a substrate for flat panel display, at least the surface of which substrate is provided with a metal or glass base material. This cleaning composition contains a copolymerized compound (I) at least satisfying the following conditions (i)-(iii). (i) A constitutional unit A1 derived from an acrylic acid is not less than 20 mol% of the total constitutional units. (ii) The total of the constitutional unit A1 derived from an acrylic acid and a constitutional unit A2 derived from 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid is not less than 90 mol% of the total constitutional units. (iii) The ratio between the constitutional unit A1 and the constitutional unit A2 [constitutional unit A1 (mol%) / constitutional unit A2 (mol%)] in the total constitutional units is from 91/9 to 95/5.

(57) 要約: 本発明は、金属質又はガラス質基材が少なくとも表面に構成される、記録媒体用基板、フォトマスク用基板、又はフラットパネルディスプレイ用基板の洗浄に用いる洗浄剤組成物であって、(I)以下の(i)～(iii)を少なくとも満たす共重合化合物、(i)アクリル酸由来の構成単位A1が、全構成単位中の20モル%以上である、(ii)アクリル酸由来の構成単位A1と2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸由来の構成単位A2の合計含有量が、全構成単位中の90モル%以上である、(iii)全構成単位中の構成単位A1と構成単位A2との含有量比[構成単位A1(モル%) / 構成単位A2(モル%)]が、91/9～95/5であるを含有する洗浄剤組成物に関する。

WO 2007/116669 A1